日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP 03/04666

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application:

2002年 4月15日

REC'D' 0 6 JUN 2003

出願番号 Application Number:

特願2002-112353

WIPO PCT

[ST.10/C]:

[JP2002-112353]

出 願 人 Applicant(s):

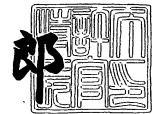
東亞合成株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2003年 5月20日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 太田信一



特2002-112353

【書類名】

特許願

【整理番号】

2K2048G010

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

C08G 65/00

【発明者】

【住所又は居所】

愛知県名古屋市港区船見町1番地の1 東亞合成株式会

社高分子材料研究所内

【氏名】

稲田 和正

【特許出願人】

【識別番号】

000003034

【氏名又は名称】

東亞合成株式会社

【代表者】

福澤 文士郎

【代理人】

【識別番号】

100101719

【住所又は居所】

東京都港区西新橋1丁目4番10号 野口特許事務所

【弁理士】

【氏名又は名称】

野口 恭弘

【電話番号】

03-3519-7788

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

081571

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

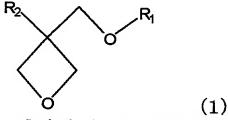
【書類名】 明細書

【発明の名称】 活性エネルギー線硬化型樹脂組成物

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリブタジエン骨格または水素添加ポリブタジエン骨格を有する分子の1分子あたりグリシジルオキシ基を2個以上有するポリマー(成分A)、下記式(1)のオキセタン化合物(成分B)及び光カチオン重合開始剤(成分X)を含むことを特徴とする活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。

【化1】



式(1)中、R $_1$ は炭素数 6~30個の分岐を有してもよいアルキル基又は炭素数が 4~10のアルキル基で置換されたフェニル基を表し、R $_2$ は水素原子または炭素数 1~6個の分岐を有してもよいアルキル基を表わす。

【請求項2】 成分A以外の多官能エポキシ化合物および多官能オキセタン 化合物を、樹脂成分全体を100部として10部以上含まない請求項1記載の活 性エネルギー線硬化型樹脂組成物。

【請求項3】 炭素数8~30の単官能エポキシ化合物(成分C)を含む請求項1または2記載の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。

【請求項4】 ガラス転移温度が-30℃以下であるポリマー(成分D)を含む請求項1ないし3いずれか1つに記載の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物

【請求項5】 ポリマー(成分D)が、ポリブタジエンまたはポリイソプレンに無水マレイン酸を1分子当たり1~20個付加した化合物、もしくはこれらをアルコールで開環させた化合物である請求項4記載の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。

【請求項6】 請求項1ないし5いずれか1つに記載の活性エネルギー線硬 化型樹脂組成物を活性エネルギー線を照射することにより硬化してなる硬化物の 動的粘弾性測定の物性値が、25 \mathbb{C} 、1 H z において貯蔵弾性率(G')10 0 P a 以下、かつ t a n δ 0. 1 以下であることを特徴とする硬化物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、電子機器部材または光学部材を製造する際に用いる、また、印刷等にも使用可能な活性エネルギー線硬化型樹脂組成物に関するものである。また、本発明は、該活性エネルギー線硬化型組成物を硬化してなる、室温において非常に低弾性率でありながら形状変化後の復元性に優れ、かつITO(スズドープ酸化インジウム)蒸着膜等の濡れ性の悪い基材への密着性に優れた硬化物に関する。さらに、本発明は、透明タッチパネルのITO蒸着膜またはこの上に形成された配線を被覆する被覆物や、光ファイバーをコーティングする被覆物に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、電子機器部材または光学部材を製造する際に、活性エネルギー線硬化型 樹脂組成物を使用する場面が増えている。その理由としては、生産性が高いこと 、有機溶剤を使用しないために作業環境が向上すること、等が挙げられる。

このような背景から、活性エネルギー線硬化型樹脂組成物に対し、その使用される部位に応じて、様々な物性が要求されるようになってきた。

例えば、アナログ抵抗膜方式の透明タッチパネルに於いては、一般に、上面と下面の抵抗膜間に樹脂製のドットスペーサーが使用される。タッチパネルの感度を向上させようとする場合、このドットスペーサーは、室温付近に於いて、より低い弾性率と形状変化後の優れた復元性を共に満たすことが必要である。また、ITO等の抵抗膜上に銀等による導電膜の配線を施し、これを樹脂で被覆して絶縁する場合に於いても、感度の向上を考えると、被覆する絶縁層が低弾性率であり、かつ形状変化後の復元性に優れることが必要となる。

ここで、ドットスペーサーや絶縁層は、ITO蒸着膜や銀等の、基材に対する 密着性に優れることが好ましい。

また、ドットスペーサーや絶縁層は形状が微細であるため、印刷により塗布さ

れることが多いが、この場合、樹脂は適度な粘度を有することが必要となる。

[0003]

従来の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物でも、その硬化物の弾性率が低いというだけのものであれば、UV粘着材等の樹脂が存在する。しかしながら、これらは形状変化後の復元性に劣るものであり、言い換えれば、動的粘弾性測定におけるtanδが大きいものである。

一方、室温付近における弾性率(貯蔵弾性率)が低く、かつ形状変化後の復元性に優れた(t an δ が小さい)硬化物を与える活性エネルギー線硬化型樹脂組成物は数少なく、そのレベルが、動的粘弾性測定(25 $\mathbb C$ 、1 Hz)において、貯蔵弾性率(G')が10 5 Pa以下かつt an δ が0. 1以下である場合、シリコーン系以外のものでは見当たらない。しかし、シリコーン系の樹脂は、各種基材への密着性が極端に悪いため、基材への密着性が要求される場面には適さない。

[0004]

また、シリコーン系樹脂を含まない活性エネルギー線硬化型樹脂組成物でも、 基材が濡れ性の悪い金属酸化物蒸着膜である場合、例えばITOの蒸着膜である 場合は、十分な密着性を得ることはできなかった。

すなわち、従来の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物では、動的粘弾性測定(25 \mathbb{C} 、1 \mathbb{H} \mathbb{Z})において、貯蔵弾性率(\mathbb{G} ')が1 0 5 \mathbb{P} a 以下かつ t a n δ が 0 0 1 以下であり、しかも \mathbb{I} \mathbb{T} 0 蒸着膜への密着性に優れた硬化物を与えることはできなかった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

本発明が解決しようとする課題は、低弾性率でありながら形状変化後の復元性に優れ、ITO蒸着膜等の濡れ性の悪い基材への密着性にも優れた硬化物を与え、さらには印刷等に使用可能な適度な粘度を有する活性エネルギー線硬化型樹脂組成物を提供することである。

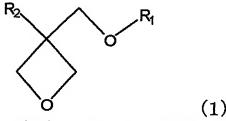
[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明者は、前記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、以下の発明により前記課題を解決し得ることを見出し、本発明を完成した。

ポリブタジエン骨格または水素添加ポリブタジエン骨格を有する分子の1分子 あたりグリシジルオキシ基を2個以上有するポリマー(成分A)、下記式(1) のオキセタン化合物(成分B)及び光カチオン重合開始剤(成分X)とを含むこ とを特徴とする活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。

【化2】



式(1)中、R $_1$ は炭素数 6~30個の分岐を有してもよいアルキル基又は炭素数が 4~10のアルキル基で置換されたフェニル基を表し、R $_2$ は水素原子または炭素数 1~6個の分岐を有してもよいアルキル基を表わす。

[0007]

【発明の実施の形態】

以下、本発明を詳細に説明する。

なお、以下の文においては、ポリブタジエンおよび水素添加ポリブタジエンを 単に「ポリブタジエン」と、また、ポリブタジエン骨格および水素添加ポリブタ ジエン骨格を、単に「ポリブタジエン骨格」と言う。

[0008]

本発明の活性エネルギー線硬化型組成物は、ポリブタジエン骨格を有する分子 1分子あたりグリシジルオキシ基を2個以上有するポリマー(成分A)、後述のオキセタン化合物(成分B)及び光カチオン重合開始剤(成分X)を必須成分として含有する。本発明においては、成分A以外の多官能エポキシ化合物および/または多官能オキセタン化合物を、組成物の合計100部に対し10部以上含まないことが好ましい。なお、本発明において配合比率は、重量に基づく。また、本発明の活性エネルギー線硬化型組成物は、単官能エポキシ化合物(成分C)および/またはガラス転移温度が-30℃以下であるポリマー(成分D)を任意成

分として含有しても良い。以下、本発明の活性エネルギー線硬化型組成物を構成 する必須成分及び任意成分につき説明する。

[0009]

(成分A)

成分Aは、ポリブタジエン骨格を有する分子1分子あたりグリシジルオキシ基を2個以上有するポリマーであり、例えば、両末端に水酸基を有するポリブタジエンの両末端水酸基をグリシジルオキシ基としたもの、両末端にカルボキシル基を有するポリブタジエンの両末端にグリシジルオキシ基を1分子内に2個有する分子を付加させたもの等が挙げられる。本発明においては、両末端に水酸基を有するポリブタジエンの両末端水酸基をグリシジルオキシ基としたものが好ましく用いられる。

[0010]

ここで、ポリブタジエンは、ラジカル重合で得たものであっても、アニオン重合で得たものであっても良い。成分Aの分子量は、好ましくは1,000~100,000、特に好ましくは2,000~100,000、特に好ましくは2,000~10,000である。

また、本発明における水素添加ポリブタジエンとは、好ましくはその水素添加率が60%以下であり、さらに好ましくは40%以下であり、最も好ましくは20%以下である。水素添加率を高くしすぎると相溶性が悪くなる場合がある。

[0011]

成分Aとなるポリマーの主鎖骨格は、ポリブタジエン単独のものに限らず、アクリロニトリル、スチレン、ブテン等、ブタジエン以外のモノマーとのブロック 共重合体であっても良い。ただし、主鎖骨格中にポリブタジエンのブロックを有することが必須である。

[0012]

本発明における成分Aは、グリシジルオキシ基を1分子中に2個以上有するものであるが、グリシジルオキシ基の好ましい個数は2個である。グリシジルオキシ基の個数が多すぎると、硬化物の貯蔵弾性率が大きくなり好ましくない。

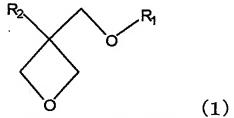
[0013]

成分Aの具体例として、水酸基末端ポリブタジエンの水酸基をエピクロルヒドリンと反応させたもの、水酸基末端ポリブタジエンの両水酸基をグリシジルオキシ基としたデナレックスR-45EPT(ナガセケムテクス社製)、α,ωーポリブタジエンジカルボン酸由来のNISSO-PB EPB-13(日本曹達(株)製)が挙げられる。

[0014]

(成分B)

本発明における成分Bは、下記式(1)で示されるオキセタン化合物である。 【化3】



式中、R $_1$ は炭素数 6~30個の分岐を有してもよいアルキル基又は炭素数が 4~10の分岐を有しても良いアルキル基で置換されたフェニル基であり、例えば、ヘキシル基、オクチル基、2-エチルヘキシル基、オクタデシル基、2,4 -ジーtert-ブチルフェニル、2,4-ジーtert-アミルフェニル基などが挙げられる。また、R $_2$ は水素原子または炭素数 1~6個の分岐を有してもよいアルキル基で、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、 $_1$ 00円の基、 $_2$ 10円の基、 $_2$ 10円の基、 $_3$ 10円の基本で、例えば、メチル基、 $_3$ 10円の基本で、例えば、 $_3$ 10円の基本でが基本で、例えば、 $_3$ 10円の基本での表面により、 $_3$ 10円の基本では一切を表面により、 $_3$ 10円の基本では、 $_3$ 10円の金本では、 $_3$ 10円の基本では、 $_3$ 10円の金本では、 $_$

[0015]

R₁又はR₂で示されるアルキル基は置換基を有していても良い。この置換基としては、カチオン重合を阻害しない限り任意の置換基が許容され、カチオン重合に悪影響を及ぼさない任意の置換基によりアルキル基を置換することができる。このアルキル基に許容される置換基群としては、C1~12のアルコキシ基、C2~12のアシルオキシ基、C2~12のアルコキシカルボニル基、フェニル基、ベンジル基、ベンゾイル基、ベンゾイルオキシ基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、フェニルチオ基、およびトリエトキシシリル基が例示できる。

[0016]

成分Bの具体例として、 R_1 が炭素数 8 の 2 - エチルヘキシル基で R_2 がエチル基であるオキセタンモノマーOXT-212(東亞合成(株)製)、および、 R_1 が炭素数 1 8 のオクタデシル基で R_2 がエチル基であるオキセタンモノマーOXR-18(東亞合成(株)製)などがある。

オキセタン化合物は、反応性が良好であり、短時間での光硬化が達成されるため好ましく使用される。 R_1 が2ーエチルヘキシル基であり、 R_2 がエチル基であるオキセタン化合物は、優れた希釈剤、硬化促進剤、柔軟性付与剤および表面 張力低下剤として、好ましく使用される。

[0017]

本発明の組成物は、成分Aおよび成分Bを必須の樹脂成分として含む。これにより、組成物を硬化することにより得られる硬化物のガラス転移温度を下げ、かつ架橋密度を小さくすることができる。結果として、室温付近における弾性率が小さく、かつ形状変化後の復元性が良い硬化物が得られる。また、本発明の硬化物はITO蒸着膜のように非常に濡れ性の悪い基材に対しても、優れた密着性を有する。さらに、成分Bが重合性に優れるため、硬化性に優れるばかりか、脆くない硬化物が得られる。その上、高粘度の成分Aと低粘度の成分Bから構成されるため、組成物の粘度を幅広い範囲に調整することが可能である。

[0018]

本発明における成分Aの好ましい配合部数は、成分Aの構造によって異なるが、樹脂成分全体を100部として1~50部であり、好ましくは10~50部、より好ましくは20~45部である。1部より少ない場合は、硬化性が悪くなる、均一な硬化物が得られない等の問題が生じる。また、50部より多い場合は、硬化物の弾性率が大きくなるので好ましくない。

一方、本発明における成分Bの配合部数は特に限定するものではないが、樹脂成分全体を100部として10~80部であり、好ましくは10~70部、より好ましくは20~60部である。成分Bが少なすぎる場合、例えば10部未満である場合は、硬化性が悪くなるため好ましくない。また、80部より多い場合、組成物の粘度が低くなりすぎ、フィラー等を配合したとしても印刷に適した粘度

とすることが困難となるので、好ましくない。

なお、本発明において「樹脂成分」とは樹脂組成物から光カチオン重合開始剤 (成分X)等の重合開始剤を除いたものを言う。さらに、充填剤、増量剤その他の添加剤が用いられている場合は、これらを除いたものを言う。

[0019]

本発明の活性エネルギー線硬化型組成物は、成分A以外の多官能エポキシ化合物および多官能オキセタン化合物を樹脂成分全体を合計100部として10部以上含まないことが好ましい。換言すると、成分A以外の多官能エポキシ化合物および/または多官能オキセタン化合物を含有する場合には、これらの含有量の合計は、樹脂成分全体を合計100部として10部未満であることが好ましく、5部未満が更に好ましい。多官能オキセタン化合物および多官能エポキシ化合物は、組成物の硬化速度を向上させ、さらに硬化後の強度を制御する目的で使用することもできるが、その含有率が樹脂成分100部に対し10部以上となると、硬化物の弾性率が大きくなり好ましくない。

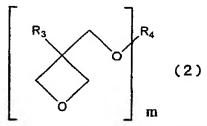
[0020]

成分A以外の多官能エポキシ化合物として、例えば、ジシクロペンタジエンジオキサイド、リモネンジオキサイド、4ービニルシクロヘキセンジオキサイド、(3,4ーエポキシシクロヘキシルメチル3,4ーエポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ジ(3,4ーエポキシシクロヘキシル)アジペート、ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ハロゲン化ビスフェノールA型エポキシ樹脂、ビスフェノールF型エポキシ樹脂、の一、m一、pークレゾールノボラック型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂等が例示される。

[0021]

多官能オキセタン化合物としては、下記式(2)で表される化合物が例示される。

【化4】



式中mは2以上の自然数を示し、 R_3 はメチル基またはエチル基を示し、 R_4 は血価の連結基を示す。

[0022]

(成分C)

本発明の組成物には、上記成分Aおよび成分Bの他に、炭素数8~30の単官 能エポキシ化合物(成分C)を配合することも可能である。

[0023]

炭素数8~30の単官能エポキシ化合物(成分C)は、分岐を有しても良い炭素数8~30のアルキル基に1個のエポキシ基を有する化合物である。このアルキル基としては、オクタン、デカン、ドデカン、テトラデカン、ヘキサデカンおよびオクタデカンなどが挙げられる。

[0024]

成分Cの具体例としては、1,2-エポキシヘキサデカン(商品名:UVR-6216、ユニオン・カーバイド日本(株))が挙げられる。

[0025]

本発明の組成物への成分Cの配合は、硬化物の硬化性を極端に悪くしない程度 に適宜に調整するべきであり、樹脂全体を100部として、好ましくは50部以 下であり、さらに好ましくは40部以下である。50部より多い場合、組成物の 硬化性が悪くなるので好ましくない。

[0026]

(成分D)

本発明の組成物をスクリーン印刷等の方法で塗工する場合、適度な粘度が必要になる。最終的な粘度はシリカ等のフィラーを配合して増加させることができるが、樹脂として室温で100mPa・s以下のものは、スクリーン印刷等に好適

に使用することができない。このような場合、樹脂として室温で数百mPa・s 以上の粘度を有することが必要であり、数千mPa・sの粘度であることが好ま しい。

上述のような理由から、組成物の硬化前の粘度を高くする目的で、本発明の組成物には、ガラス転移温度が-30℃以下であるポリマー(成分D)を配合することできる。ガラス転移温度が-30℃より高いポリマーを配合していくと、硬化物の室温付近における弾性率および t a n δ が大きくなるため好ましくない。また、成分Dは、硬化前および硬化後における相溶性の良いものが好ましい。

[0027]

本発明の組成物への成分Dの配合は、樹脂全体を100部として、好ましくは 50部以下であり、さらに好ましくは40部以下である。50部より多い場合は 、硬化物の室温付近におけるtan8が大きくなるので好ましくない。

[0028]

上記ポリマー(成分D)の好適な例としては、無水マレイン酸を1分子当たり 1~20個付加させたポリブタジエンまたはポリイソプレン、またはこれらの酸 無水物をアルコールにて開環させたものが挙げられる。ここで、酸無水物は、適当なアルコールにて開環させておいた方が、組成物の経時安定性の点から好ましい。酸無水物を開環させるアルコールは特に限定するものではないが、炭素数1~10のアルキルアルコールであることが好ましく、特に好ましいのはメタノールである。

[0029]

成分Dの具体例としては、水酸基末端ポリブタジエン(出光石油化学(株)製、Poly bd R-45HT)、 α , ω -ポリブタジエングリコール(日本曹達製、G-3000)、 α , ω -ポリブタジエングリコールの水素添加物(日本曹達製、GI-3000)、 α , ω -ポリブタジエンジカルボン酸(日本曹達製、C-1000)、 α , ω -ポリブタジエンジカルボン酸の水素添加物日本曹達製、CI-1000)、ポリイソプレンに無水マレイン酸を付加した後、メタノールにて開環したポリマー((株)クラレ製、クラプレンLIR-410)、無水マレイン酸を付加したポリブタジエン(日本石油化学(株)製、日石ポリブ

タジエンM-1000-80)等が挙げられる。

[0030]

本発明の組成物には、活性エネルギー線の照射によりカチオン重合を開始させるカチオン重合開始剤(成分X)を配合することが必要である。カチオン重合開始剤は、樹脂組成物に溶解することが必要であり、硬化性に優れるものが好ましい。

このカチオン重合開始剤としては、ジアゾニウム塩、ヨードニウム塩、スルフォニウム塩、セレニウム塩、ピリジニウム塩、フェロセニウム塩、フォスフォニウム塩、チヲピリニウム塩が挙げられるが、熱的に比較的安定である芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルフォニウム塩等のオニウム塩光開始剤が好ましく使用される。なお、オニウム塩光開始剤を活性化させるためには、活性エネルギー線として紫外線や可視光を照射することが好ましい。

[0031]

芳香族ヨードニウム塩及び芳香族スルフォニウム塩等のオニウム塩光開始剤を使用する場合、アニオンとしては ${\rm BF}_4$ 、 ${\rm AsF}_6$ 、 ${\rm SbF}_6$ 、 ${\rm PF}_6$ 、 ${\rm B(C}_6$ ${\rm F}_5$) ${}_4$ などが挙げられ、これらの中でも、 ${\rm B(C}_6$ ${\rm F}_5$) ${}_4$ をアニオンとしたヨードニウム塩はオキセタン化合物との相溶性も良く好適である

[0032]

本発明においては、活性エネルギー線として、X線、電子線等を使用することもできるが、紫外線を用いることが好ましい。本発明において活性エネルギー線として紫外線を使用する場合には、その波長範囲は特に限定されないが、150 ~400 n m であることが好ましく、200 ~380 n m であることがより好ましい。紫外線を用いる場合、上述した種々の光カチオン重合開始剤を活性化して本発明の硬化型樹脂組成物のカチオン重合を効率よく開始できる。本発明の樹脂組成物に対して好適な光カチオン重合開始剤は、カチオン成分がビス(アルキルフェニル)ヨードニウム、アニオン成分がPF $_6$ 、 $_5$ $_5$ $_4$ $_8$ であるものであり、特に好適なものを具体的に挙げると、ビス(ドデシルフェニル)ヨードニウムへキサフルオロアンチモネート(GE東芝シリコー

ン社製、UV-9380Cの主成分)、トリルクミルヨードニウムテトラキス(ペンタフルオロフェニル)ボレート(ローディア社製、PHOTOINITIA TOR2074)等が挙げられる。

[0033]

また、本発明の樹脂組成物には、必要に応じてさらにカチオン重合開始剤の活性を高めるため、増感剤を併用することもできる。上記光カチオン重合開始剤と併用する増感剤は特に限定するものではないが、一般的に使用される光ラジカル重合開始剤が好適に使用できる。

本発明において用いることができる典型的な増感剤は、クリベロがアドバンスドイン ポリマーサイエンス (Adv. in Plymer Sci.,62,1(1984)) で開示している化合物を用いることが可能である。具体的には、ピレン、ペリレン、アクリジンオレンジ、チオキサントン、2ークロロチオキサントン及びペンゾフラビン等がある。

[0034]

さらに、一般的に使用可能な光ラジカル重合開始剤として、ベンゾフェノン、2,4ージエチルチオキサントン、2ーイソプロピルチオキサントン、2,4ージクロロチオキサントン等のチオキサントン類、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル等のベンゾインエーテル類、2,2ージメトキシー1,2ージフェニルエタンー1ーオン等のベンジルジメチルケタール類、2ーヒドロキシー2ーメチルー1ーフェニルプロパンー1ーオン、1ー(4ーイソプロピルフェニル)ー2ーヒドロキシー2ーメチルプロパンー1ーオン、1ーヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン等のαーヒドロキシアルキルフェノン類、カンファーキノン等のαージカルボニル化合物等が挙げられる。

本発明においては、チオキサントン類が最もオニウム塩の活性を高め好適である。

[0035]

光カチオン重合開始剤(成分X)および増感剤の配合量は、紫外線の照射量や 樹脂の硬化性に応じて適宜に調整できるが、概ね、樹脂組成物の合計100部に 対し、0.1~10部とすることが好ましい。0.1部よりも少ない場合は硬化性に劣り、逆に10部より多い場合は硬化物に真に必要な成分を減少させて硬化物の物性が低下する場合や、硬化物の着色が激しくなる場合がある。

[0036]

本発明の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物は、活性エネルギー線で硬化させた後、更に加熱して重合し重合率を高めることもできる。この場合は、熱力チオン重合開始剤を配合することが好ましい。

この熱力チオン重合開始剤とは、加熱により活性化されエポキシ化合物および オキセタン化合物などが有している開環重合性基の開環重合を誘発するものであ り、第四級アンモニウム塩、ホスホニウム塩およびスルホニウム塩などの各種オ ニウム塩類などが例示できる。

上記オニウム塩類としては、例えば、アデカオプトンCP-66およびアデカオプトンCP-77 (いずれも商品名、旭電化工業(株)製)、サンエイドSI-60L、サンエイドSI-80LおよびサンエイドSI-100L (いずれも商品名、三新化学工業(株)製)、およびCIシリーズ(日本曹達(株)製)などの市販の化合物を用いることができる。

熱カチオン重合開始剤の配合割合は、樹脂組成物100部に対し、0.01~5部の範囲とすることが好ましい。この配合割合が0.01部未満の場合には、熱の作用によりこれが活性化しても、開環重合性基の開環反応を十分に進行させることができないことが有る。また、これを5重量部を越えて配合したとしても、重合を進行させる作用はそれ以上高まらず、逆に硬化性能が低下することがある。

[0037]

なお、本発明の樹脂組成物には、粘度上昇、チクソトロピー性の付与等を目的 として、シリカ微粒子等のフィラーを配合することもできる。フィラーの添加量 は適宜に調整可能であるが、低弾性率の維持等の面から、0~10部とするのが 好ましい。

さらに、本発明の樹脂組成物には、密着性の更なる向上を目的として、シランカップリング剤等のカップリング剤を配合することも可能である。

[0038]

本発明の樹脂組成物は、室温において非常に低弾性率でありながら形状変化後の復元性に優れ、かつ濡れ性の悪い基材への密着性に優れた硬化物を与えることから、このような物性を必要とする電子機器部材および光学部材の材料として、好適に使用できる。

また、室温における粘度を数百~数千mPa・sに調整することができるため、フィラーを配合するなどした後、スクリーン印刷等の印刷によって微細な形状に塗工することができる。

具体的には、透明タッチパネルの製造や、光ファイバーの製造等に用いられる。前者に於いては、例えば、ITO蒸着膜等の抵抗膜および/またはこの上に形成される導電膜を被覆する絶縁層として、或いは、ドットスペーサーとして使用することができる。また、後者に於いては、コーティング材として使用することができる。

[0039]

以下、タッチパネル用被覆物の製造について説明する。

タッチパネル用被覆物として本発明の樹脂組成物を用いるには、活性エネルギー線の照射によりカチオン重合を開始させるカチオン重合開始剤を配合しておくことが好ましい。また、この重合を促進させるために増感剤を併用することもできる。本組成物を活性エネルギー線を照射して硬化させた後に、重合度を高めるため、再度活性エネルギー線を照射したり、または加熱したりすることにより、後重合させることもできる。熱重合させるときは熱カチオン重合開始剤を配合しておくことが好ましい。また、粘度を調節するために、シリカ微粒子等のフィラーを配合しておいても良い。

[0040]

ドットスペーサーとして使用する場合、透明絶縁基板上にスパッタ法等によって形成されたITO蒸着膜に、本発明の樹脂組成物をスクリーン印刷等の方法で印刷し、縦横高さ数十μmスケールのドットを形成させる。これに紫外線等の活性エネルギー線を照射することにより、印刷された樹脂組成物を硬化させる。本発明の樹脂組成物は非常に低弾性率であり、かつ形状変化後の復元性に優れてい

るため、感度の高いタッチパネルを作成する場合に好適に使用される。なお、濡れ性の悪いITO蒸着膜に対しても密着性が良いため、信頼性の点でも優れたものとなる。

[0041]

ITO蒸着膜上に形成される銀等の導電膜に被覆して絶縁層とする場合でも、上述のドットスペーサーの時と同様、スクリーン印刷等の印刷技術が好適に使用できる。例えば、抵抗膜方式タッチパネルの構造を簡単に述べると、ITO蒸着膜からなる透明な抵抗膜がパネル全体に形成され、その両端に銀等の導電膜が帯状に形成されているが、その両端の導電膜を被覆するように樹脂を塗工する場合、スクリーン印刷等の印刷による方法が好適である。その後、活性エネルギー線の照射によって樹脂を硬化させ、低弾性率、かつ形状変化後の復元性に優れた絶縁層を得ることができる。これにより、両端部においても、感度の高いタッチパネルとすることができる。なお、導電膜の位置は、パネルの両端にある場合に限ったものではない。

[0042]

光ファイバー用被覆物の製造について以下に説明する。

本発明の樹脂組成物は、光ファイバーの被覆物としても好適に使用できる。光ファイバーの第一次被覆層に用いる樹脂組成物としては、塗布性に優れた低い粘度、優れた硬化性、柔軟性、広い温度範囲における物性変化が少ないこと、吸水性が低いこと等の物性が必要である。

本発明の樹脂組成物は、粘度を数100~数千mPa・sの範囲に調節することができるため、塗布性に優れている。また、アクリレート系等のラジカル重合 系樹脂に見られる酸素による重合阻害を受けないため、本発明の樹脂組成物は、特に薄膜とした場合に優れた硬化性を示す。また、本硬化物は、室温付近における弾性率(G') および tan δを低くするために、ガラス転移温度がマイナス数十度となるように設計されている。このことは、かなり低い温度に於いても、物性の変化が少ないことを意味する。また、本硬化物は耐熱性に優れており、幅広い温度範囲に於いても物性変化が少ない利点を有する。また、アクリレート系樹脂では吸収率が比較的高いが、本組成物はブタジエン骨格とポリエーテル構造

からなるため、本硬化物の吸水率は低いことも利点である。

以上のような物性を有することから、本発明の樹脂組成物は、光ファイバーの 第一次被覆材としても好適に使用できる。

[0043]

光ファイバーの被覆方法としては、種々の方法が使用でき、特に限定するものではないが、一例を挙げると、ガラスファイバーを熱溶解紡糸した直後に樹脂層を通過させ、紫外線を照射して硬化させる方法が挙げられる。しかし、上記方法に限定するものではなく、スプレーによる塗工等、適宜方法を変えることは可能である。また、ガラスファイバーのみならず、プラスチックファイバーに使用することもできる。

[0044]

本発明の樹脂組成物は、上記と別の観点から考えると、低弾性率かつ形状変化後の復元性に優れた硬化物を与えるため、感圧導電体の樹脂として使用することも可能である。例えば、本発明の樹脂組成物に、導電性の微粒子、および加熱して膨張するマイクロカプセルを配合し、活性エネルギー線で硬化させた後、加熱してマイクロカプセルを膨張させると、圧力印加時のみ導電性を示す感圧導電体とすることが可能である。

このような感圧導電体を使用して、種々のスイッチや透明タッチパネルを作成 することも可能である。

本発明の組成物に液晶を含有させたものを、ITOなどの透明電極による対向 電極と画素電極との間に入れて紫外線のような活性エネルギー線を照射して液晶 パネルを作製することもできる。この液晶としては、ネマティック液晶、スメク ティック液晶、コレステリック液晶などが使用できる。

本発明の組成物からの硬化物は、密着性が優れることから、電極と液晶層との剥離がなく不良品の発生を大幅に減らすことができる。

[0045]

【実施例】

以下に、実施例及び比較例を示し、本発明をより具体的に説明する。ただし、 本発明は、これらの実施例によって限定されるものではない。なお、「部」及び 「%」はいずれも質量基準によるものとする。

[0046]

表1に示す成分を常法に従って混合し、活性エネルギー線硬化型樹脂組成物を 調製した後、物性を評価した。

表1における略号は、以下の化合物を示す。

R45EPT:成分A、両末端に水酸基を有するポリブタジエンの両水酸基ををグリシジルオキシ基としたもの、ナガセケムテクス社(株)製デナレックスR-45EPT

EHOX:成分B、3-エチル-3-(2-エチルヘキシロキシメチル) オキセタン、東亞合成(株) 製アロンオキセタンOXT-212

UVR6216:成分C、1,2-エポキシヘキサデカン、ダウ・ケミカル日本(株)製UVR-6216

LIR410:成分D、ポリイソプレンに無水マレイン酸を付加した後、メタノールにて開環したポリマー、(株)クラレ製クラプレンLIR-410

UV9380C:光カチオン重合開始剤、ビス(ドデシルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオロアンチモネートを主成分とする光カチオン重合開始剤、GE 東芝シリコーン(株)製UV-9380C

UVR6110:3,4-エポキシシクロヘキシルメチル-3,4-エポキシシクロヘキサンカルボキシレート、ダウ・ケミカル日本(株)製UVR-611

[0047]

物性の評価方法を以下に、また、評価結果を表2に示す。

〇粘度

E型粘度計にて25℃における粘度を測定した。

O動的粘弾性測定(G'およびtanδ)

ポリテトラフルオロエチレン製の板に厚さ1 mmの枠を作成し、樹脂を流し込んだ後、水銀ランプにより紫外線を照射した。365 nmにおける強度25 mW $/ \text{ cm}^2$ で2分間照射し、裏面まで硬化したことを確認した後、表裏合計4回照射した。

得られた硬化物の動的粘弾性測定を、測定温度 25 \mathbb{C} 、振動数 1 Hz で行い、 貯蔵弾性率(G')および t a n δ を評価した。

〇密着性

ポリエチレンテレフタレート (PET)上に蒸着したITOに樹脂をバーコーターにて50μmに塗工し、紫外線を照射して樹脂を硬化させた。紫外線の照射条件は、160W/cm集光型高圧水銀灯 (一灯)、水銀灯高さ10cm、コンベアスピード10m/分、パス回数は指で硬化を確認してからさらに5回とした

密着性は、硬化膜について、JIS K-5400のXカットテープ法に従って評価した。

[0048]

【表1】

	実施例1	実施例 2 (部)	実施例3	比較例1
ЕНОХ	60	3 0	2 0	9 0
R45EPT	4 0	3 0	3 0	
UVR6216		2 0	2 0	-
LIR410		2 0	3 0	
UVR6110				10
UV9380C	1	1.	1	1

[0049]

【表2】

	粘度(25℃)	G' (Pa)	tan δ	密着性
	(mPa·s)			(点)
実施例 1	197	9. 0×10 ⁴	0. 09	10
実施例 2	822	4. 0×10⁴	0. 10	10
実施例 3	2, 259	3. 7×10 ⁴	0. 10	10
比較例1	5	4. 0×10 ⁵	0. 01	2

[0050]

【発明の効果】

本発明の活性エネルギー線硬化型樹脂組成物は、非常に低弾性率でありながら 形状変化後の復元性に優れ、ITO蒸着膜等の濡れ性の悪い基材への密着性にも 優れた硬化物を与える、印刷等に使用可能な適度な粘度を有する樹脂組成物であ るため、このような物性を必要とする電子機器部材または光学部材を製造する際 に好適に使用できる。 【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 低弾性率でありながら形状変化後の復元性に優れ、ITO蒸着膜等の濡れ性の悪い基材への密着性にも優れた硬化物を与え、さらには印刷等に使用可能な適度な粘度を有する活性エネルギー線硬化型樹脂組成物を提供すること。

【解決手段】 ポリブタジエン骨格または水素添加ポリブタジエン骨格を有する分子の1分子あたりグリシジルオキシ基を2個以上有するポリマー(成分A)、3-アルキル-3-アルコキシメチル-オキセタン化合物等(成分B)及び光カチオン重合開始剤(成分X)を含むことを特徴とする活性エネルギー線硬化型樹脂組成物。

【選択図】

なし

認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-112353

受付番号

50200546634

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0095

作成日

平成14年 4月16日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 4月15日

出願人履歷情報

識別番号

[000003034]

1. 変更年月日 1994年 7月14日

[変更理由] 名称変更

住 所 東京都港区西新橋1丁目14番1号

氏 名 東亞合成株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:			
☐ BLACK BORDERS			
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES			
FADED TEXT OR DRAWING			
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING			
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES			
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS			
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS			
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT			
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY			

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

✓ □ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.